



KINTEK SOLUTION

Mpcvd 기계 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



실험실 및 다이아몬드 성장을 위한 원통형 공진기 Mpcvd 기계

품목 번호: KTWB315



소개

보석 및 반도체 산업에서 다이아몬드 보석 및 필름을 성장시키는 데 사용되는 마이크로웨이브 플라즈마 화학 기상 증착 방법인 원통형 공진기 MPCVD 기계에 대해 알아보십시오. 기존 HPHT 방법에 비해 비용 효율적인 이점을 발견하십시오.

자세히 알아보기

<p>마이크로파 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 마이크로파 주파수 2450±15MHZ, • 출력 전력 1~10 KW 지속적으로 조정 가능 • 마이크로파 출력 전력 안정성: • 마이크로파 누출 ≤2MW/cm2 • 출력 도파관 인터페이스: FD-340, 430 표준 플랜지가 있는 WR340, 430 • 찬물 교류: 6-12L/min • 시스템 정재파 계수: VSWR ≤ 1.5 • 전자레인지 수동 3핀 조절기, 여기공동, 고전력부하 • 입력 전원 공급 장치: 380VAC/50Hz ± 10%, 삼상
<p>반응 챔버</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 진공 누설률 • 한계 압력은 0.7 Pa 미만입니다(Pirani 진공 게이지로 표준 설정). • 챔버의 압력 상승은 12시간의 압력 유지 후 50Pa를 초과하지 않아야 합니다. • 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 • 챔버 유형: 원통형 공진 챔버, 최대 지지력 10KW, 304 스테인리스 스틸, 수냉식 중간층 및 고순도 석영 플레이트 밀봉 방법. • 흡기 모드: 상단 환형 균일 흡기 • 진공 밀봉: 메인 챔버와 주입 도어의 하단 연결부는 고무 링으로 밀봉되고 진공 펌프와 벨로우즈는 KF로 밀봉되며 석영판은 금속 C-링으로 밀봉되고 나머지는 CF로 밀봉됩니다. • 관찰 및 온도 측정 창: 8 관찰 포트 • 챔버 앞 샘플 로드 포트 • 0.7KPa~30KPa의 압력 범위 내에서 안정적인 토출(전원 압력이 일치해야 함)
<p>샘플 홀더</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 샘플 table≥72mm의 직경, 유효 사용 area≥66 mm • 베이스 플레이트 플랫폼 수냉식 샌드위치 구조 • 샘플 홀더는 챔버에서 전기적으로 고르게 들어 올리고 내릴 수 있습니다.
<p>가스 흐름 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 모든 금속 용접 에어 디스크 • 장비의 모든 내부 가스 회로에는 용접 또는 VCR 조인트를 사용해야 합니다. • 5채널 MFC 유량계, H2/CH4/O2/N/Ar, H2: 1000sccm; CH4: 100sccm; O2: 2sccm; N2: 2sccm; Ar: 10sccm • 작동 프레스 0.05-0.3MPa, 정확도 ±2% • 각 채널 유량계에 대한 독립적인 공압식 밸브 제어
<p>냉각 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 라인 수냉식, 온도 및 흐름의 실시간 모니터링. • 시스템 냉각수 흐름은 ≤ 50L/min입니다. • 냉각수 압력은

- 온도 센서
- 외부 적외선 온도계의 온도 범위는 300-1400°C입니다.
 - 온도 제어 정확도

제어 시스템	<ul style="list-style-type: none">• Siemens smart 200 PLC 및 터치 스크린 제어가 채택되었습니다.• 시스템에는 성장 온도의 자동 균형, 성장 기압의 정확한 제어, 자동 온도 상승, 자동 온도 강하 및 기타 기능을 실현할 수 있는 다양한 프로그램이 있습니다.• 물의 흐름, 온도, 압력 및 기타 매개변수의 모니터링을 통해 장비의 안정적인 작동과 장비의 종합적인 보호를 달성할 수 있으며 기능적 연동을 통해 작동의 신뢰성과 안전성을 보장할 수 있습니다.
--------	--

- 선택적 기능
- 센터 모니터링 시스템
 - 기관 기초 전력

915Mhz Mpcvd 다이아몬드 기계

품목 번호: MP-CVD-101



소개

915MHz MPCVD 다이아몬드 기계 및 다결정 유효 성장, 최대 면적은 8인치에 달할 수 있고, 단결정의 최대 유효 성장 면적은 5인치에 달할 수 있습니다. 이 장비는 주로 대형 다결정 다이아몬드 필름의 생산, 긴 단결정 다이아몬드의 성장, 고품질 그래핀의 저온 성장 및 성장을 위해 마이크로파 플라즈마에 의해 제공되는 에너지가 필요한 기타 재료에 사용됩니다.

자세히 알아보기

전자레인지 시스템(옵션 전원 공급 장치에 따름)	<ul style="list-style-type: none"> 작동 주파수: 915±15MHz 출력 전력: 3-75kW 지속적으로 조정 가능 냉각수 흐름: 120/min 시스템 정재파 계수: VSWR≤1.5 마이크로파 누출:
진공 시스템 및 반응 챔버	<ul style="list-style-type: none"> 누설률 최종 압력은 0.7Pa 미만입니다(이 기계에는 수입된 피라니 진공 게이지가 함께 제공됩니다). 압력을 유지한 후 12시간 후에 챔버의 압력 상승은 50Pa를 초과해서는 안 됩니다. 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 챔버 유형: 냉각된 원통형 챔버는 최대 75KW의 전력을 운반할 수 있으며 순도가 높으며 스톤 링 씰입니다. 입구 방식: 상단 스프링클러 헤드 입구. 관찰 온도 측정 창: 8개의 관찰 구멍이 수평으로 고르게 분포되어 있습니다. 샘플링 포트: 하단 리프팅 샘플링 포트
샘플 홀더 시스템	<ul style="list-style-type: none"> 샘플 스테이지 직경 ≥200mm, 단결정 유효 사용 영역 ≥130mm, 다결정의 유효 사용 영역은 ≥200mm입니다. 기판 플랫폼 수냉식 샌드위치 구조, 수직 수직 위아래.
가스 시스템	<ul style="list-style-type: none"> 전체 금속 용접 가스 플레이트 5-7 가스 라인 장비의 모든 내부 공기 회로는 용접 또는 VCR 커넥터를 사용합니다.
시스템 냉각	<ul style="list-style-type: none"> 3방향 수냉식, 온도 및 유량의 실시간 모니터링. 시스템 냉각수 유량 120L/min, 냉각수 압력
온도 측정 방법	<ul style="list-style-type: none"> 외부 적외선 온도계, 온도 범위 3001400 M

일련번호	모듈 이름	주목
------	-------	----

1	마이크로파 전원 공급 장치	국내 표준 마그네트론: Yingjie Electric / 구별 전원 공급 장치 국내 교체 소스: Watson (+30,000) 수입 마그네트론: MKS/목회자 (+100,000)
2	도파관, 핀 3개, 모드 변환기, 상부 공진기	스스로 만든
삼	진공 반응 챔버(상부 챔버, 하부 챔버, 커넥터)	스스로 만든
4	적외선 온도계, 광학 변위 부품, 브래킷	적외선 온도계, 광학 변위 부품, Fuji Gold Siemens + Schneider 브래킷
5	수냉식 테이블 모션 부품(실린더, 공작물 등)	
6	세라믹박막 진공게이지, 파라니 진공게이지	인피콘
7	진공 밸브 부품(초고진공 게이트 밸브, 정밀 공압 밸브*2, 전자 진공 충전 자동 밸브)	후지킨 + 중커 + 히맛
8	진공 펌프 및 연결 파이프 피팅, 티, KF25 벨로우즈*2, 어댑터	펌프: 플라이오버 16L
9	금속 마이크로파 밀봉 링*2; 금속 진공 밀봉 링*1; 석영판	석영: 상하이 FeilihuaSemiconductor 등급 고순도 석영
10	순환수 구성요소(조인트, 전환기 블록, 흐름 감지기)	일본 SMC/CKD
11	공압 부품(CKD 필터, airtac 다방향 솔레노이드 밸브, 파이프 피팅 및 어댑터)	
12	가스 커넥터, EP 가스관, VCR 커넥터, 필터 0.0023μm*1, 필터 10μm*2	후지킨
13	기계 케이싱, 스테인리스 스틸 테이블, 범용 휠, 발, 브래킷 고정 나사 등	맞춤 처리
14	가스 유량계*6(압력 제어 장치 1개 포함)	표준 7성, 옵션 Fuji Gold(+34,000) / Alicat(42,000)
15	가스관 가공(5방향 가스, 필터*5, 공압 밸브*5, 수동 밸브*6, 파이프라인 용접)	후지 골드
16	PLC 자동 제어	지멘스 + 슈나이더
17	몰리브덴 테이블	

진공 스테이션 Cvd 장비가 있는 스플릿 챔버 Cvd 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-CTF12



소개

직관적인 시료 확인과 빠른 냉각을 위한 진공 스테이션을 갖춘 효율적인 분할 챔버 CVD 용광로. 정확한 MFC 질량 유량계 제어로 최대 1200°C의 최대 온도.

[자세히 알아보기](#)

퍼니스 모델	KT-CTF12-60
최대 온도	1200°C
일정한 작업 온도	1100°C
용광로 튜브 재질	고순도 석영
용광로 튜브 직경	60mm
가열 영역 길이	1x450mm
챔버 재질	일본 알루미늄 시유
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일
가열 속도	0-20°C/min
열 커플	K 타입 빌드
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
슬라이딩 거리	600mm
가스 정밀 제어 장치	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4개 채널
유량	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500SCCM N2
선형성	±0.5% F.S.
반복성	±0.2% F.S.
파이프 라인 및 밸브	스테인리스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa

경사 회전 플라즈마 강화 화학 증착(Pecvd) 관로 기계

품목 번호: KT-PE16



소개

정밀한 박막 증착을 위한 기울어진 회전식 PECVD 가열로를 소개합니다. 자동 매칭 소스, PID 프로그래밍 가능 온도 제어 및 고정밀 MFC 질량 유량계 제어를 즐기십시오. 안심할 수 있는 안전 기능이 내장되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

용광로 모델	PE-1600-60
최대 온도	1600°C
일정한 작업 온도	1550°C
용광로 튜브 재료	고순도 Al2O3 튜브
용광로 튜브 직경	60mm
가열 영역 길이	2x300mm
챔버 재질	일본 알루미늄 세유
발열체	몰리브덴 디실리사이드
가열 속도	0-10°C/분
열 커플	B타입
온도 조절기	디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러
온도 조종 정확도	±1°C
RF 플라즈마 장치	
출력 파워	± 1% 안정성으로 조정 가능한 5-500W
RF 주파수	13.56MHz ±0.005% 안정성
반사력	최대 350W
어울리는	자동적 인
소음	
냉각	공기 냉각.
가스 정밀 제어 장치	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4채널

유량	MFC1: 0-5SCCM 산소 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
선형성	±0.5%FS
반복성	±0.2%FS
파이프 라인 및 밸브	스테인레스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa
유량계 컨트롤러	디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러
표준 진공 장치(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프
펌프 유량	4L/S
진공흡입구	KF25
진공 게이지	Pirani/Resistance 실리콘 진공 게이지
정격 진공 압력	10Pa
고진공 유니트(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 펌프 + 분자 펌프
펌프 유량	4L/S+110L/S
진공흡입구	KF25
진공 게이지	복합 진공 게이지
정격 진공 압력	6x10 ⁻⁵ Pa
위의 사양 및 설정은 사용자 정의할 수 있습니다.	

아니요.	설명	수량
1	노	1
2	석영관	1
삼	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열장갑	1
7	RF 플라즈마 소스	1
8	정확한 가스 제어	1
9	진공 장치	1
10	사용 설명서	1

플라즈마 강화 증발 증착 Pecvd 코팅기

품목 번호: KT-PED



소개

PECVD 코팅 장비로 코팅 공정을 업그레이드하십시오. LED, 전력 반도체, MEMS 등에 이상적입니다. 저온에서 고품질의 고체 필름을 증착합니다.

자세히 알아보기

샘플 홀더	크기	1-6인치
	회전 속도	0-20rpm 조절 가능
	가열 온도	≤800°C
	제어 정확도	±0.5°C SHIMADEN PID 컨트롤러
가스 퍼지	유량계	질량 유량계 컨트롤러(MFC)
	채널	4채널
	냉각 방식	순환 수냉식
진공 챔버	챔버 크기	Φ500mm X 550mm
	전망대	배플이 있는 풀 뷰 포트
	챔버 재질	316 스테인레스 스틸
	문 유형	전면 개방형 도어
	캡 재질	304 스테인레스 스틸
	진공 펌프 포트	CF200 플랜지
	가스 입구 포트	φ6 VCR 커넥터
플라즈마 파워	소스 전원	DC 전원 또는 RF 전원
	커플링 모드	유도 결합 또는 플레이트 용량성
	출력 파워	500W~1000W
	마이어스 전력	500v
진공 펌프	사전 펌프	15L/S 바람개비 진공 펌프
	터보 펌프 포트	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	릴리프 포트	KF25
	펌프 속도	바람개비 펌프: 15L/s, 터보 펌프: 1200l/s ~ 1600l/s
	진공 정도	≤5×10 ⁻⁵ Pa

진공 챔버

이온화/저항 진공 챔버/필름 챔버

체계	전력 공급	AC 220V /380 50Hz
	정격 전력	5kW
	치수	900mm X 820mm X870mm
	무게	200kg

액체 가스화기 Pecvd 장비가 장착된 슬라이드 Pecvd 관로

품목 번호: KT-PE12



소개

KT-PE12 슬라이드 PECVD 시스템: 넓은 전력 범위, 프로그래밍 가능한 온도 제어, 슬라이딩 시스템을 통한 빠른 가열/냉각, MFC 질량 흐름 제어 및 진공 펌프.

[자세히 알아보기](#)

용광로 모델	KT-PE12-60
최대 온도	1200°C
일정한 작업 온도	1100°C
용광로 튜브 재료	고순도 석영
용광로 튜브 직경	60mm
가열 영역 길이	1x450mm
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일
가열 속도	0-20°C/분
열 커플	벌드인케이타입
온도 조절기	디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러
온도 조종 정확도	±1°C
슬라이딩 거리	600mm
RF 플라즈마 장치	
출력 파워	± 1% 안정성으로 조정 가능한 5 -500W
RF 주파수	13.56MHz ±0.005% 안정성
반사력	최대 350W
어울리는	자동적인
소음	
냉각	공기 냉각.
가스 정밀 제어 장치	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4채널

유량	MFC1: 0-5SCCM 산소 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
선형성	±0.5%FS
반복성	±0.2%FS
파이프 라인 및 밸브	스테인레스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa
유량계 컨트롤러	디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러
표준 진공 장치(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프
펌프 유량	4L/S
진공흡입구	KF25
진공 게이지	Pirani/Resistance 실리콘 진공 게이지
정격 진공 압력	10Pa
고진공 유니트(옵션)	
진공 펌프	로터리 베인 펌프 + 분자 펌프
펌프 유량	4L/S+110L/S
진공흡입구	KF25
진공 게이지	복합 진공 게이지
정격 진공 압력	6x10 ⁻⁵ Pa

위의 사양 및 설정은 사용자 정의할 수 있습니다.

아니요.	설명	수량
1	노	1
2	석영관	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열장갑	1
7	RF 플라즈마 소스	1
8	정확한 가스 제어	1
9	진공 장치	1
10	사용 설명서	1

수동 고온 열 프레스

품목 번호: PCHT



소개

고온 핫 프레스는 고온 환경에서 재료를 프레스, 소결 및 가공하기 위해 특별히 설계된 기계입니다. 다양한 고온 공정 요구 사항을 위해 섭씨 수백도에서 섭씨 수천도 범위에서 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCHT
압력 범위	0-5.0톤
압력 프로세스	수동 가압
압력 유지 시간	1초 ~ ∞초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	중간 10-30mm
금형 모양	중형 50x90mm
용광로 직경	중형 60mm
전체 기계 크기	400x380x780(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China